

PVD Equipment Series

특징

ORIGIN의 PVD 장비 시리즈는 정밀 PVD 광학 다층막 진공증착 장비입니다.

이 장비는 박막 증착, 광학 렌즈 생산, 필터 생산, 윈도우 생산, 반도체 생산, 신소재 개발, 물질 합성, 물질 격리, 이온 클리닝, 이온 보조 증착, 진공 전자빔 용접 등 다양한 연구와 실험에 적용 가능합니다.

또한, 높은 생산성과 제품 품질 향상을 위해 최신 기술을 적용하여 설계된 장비입니다.

이 장비는 진공 챔버, 진공 펌프, 냉각 장치, 전기 제어, 공압 제어, 진공 압력 제어, 증착 막 두께 제어, 가스량 제어, E-beam source (E-Gun과 E-Gun power supply, Crucible 그리고 Crucible liner), Ion-beam source (Ion-Gun과 Ion-Gun power supply) 등으로 구성되어 있습니다.

- * ORIGIN제품의 PVD Equipment Series는 주문생산이 가능합니다.
- * 일부 레이아웃은 설치할 수 없을 수 있으니 주문하기 전에 문의하세요.
- * 타사 제품과 혼합하여 사용할 때 제품의 성능을 보증할 수 없습니다.

OC-1700



OE-1700E



ISA-7000



ISA-8000



Technical Specifications

Chamber inside dimensions (Unit: Ø)	600, 750, 1200, 1500, 1600, 2000, 2050 or Option
EB-power supplies	ISA-7000 or Option (주문제작 가능)
Crucible	1, 4, 8, 12, Etc pocket to 25cc or Option
Ion-power supplies	ISA-8000 or Option (주문제작 가능)
Chamber main material & Coating jig	SUS304 & Substrate rotation system or Option
View port	150 Diameter tempered glass include shutter, 1 to 3 Port or Option
Uniformity mask	Connector type SUS alloy
Vacuum measuring	"Granville-phillips" GP-307 or Option
Deposition controller	"Inficon" IC-6 or Option
Chamber inside shield	Separation type SUS alloy
Gas supplies	2 to 3 MFC purity 99.9%
Pressure control, Coating control	Auto, Manual
Pressure (Approximately)	Ultimate 6.0E-7 Torr, Working 2.0E-5 Torr
High vacuum pump	Option
Booster vacuum pump	Option
Rotary vacuum pump	Option
Poly cold	Option
Substrate heater	Halogen heater or Option
Main controller	Option
Line power	220Vac and 380Vac 3ph 50Hz / 60Hz ±5% Approximately 80KVA
Nonlinearity	±2% FS
Vibration in the workspace	Approximately X,Y,Z < 0.2G Less than
Operating temperation & Humidity	17 to 25°C, 20 to 70% RH

